

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年4月14日 (14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/033710 A1(51) 国際特許分類⁷: G01N 33/68,
C12Q 1/68, G01N 33/50, 33/15

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014799

(22) 国際出願日: 2004年9月30日 (30.09.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-343549 2003年10月1日 (01.10.2003) JP
特願2003-344786 2003年10月2日 (02.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社資生堂 (SHISEIDO COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1048010 東京都中央区銀座7丁目5番5号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 青木 宏文 (AOKI, Hirofumi) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 児玉 龍彦 (KODAMA, Tatsuhiko) [JP/JP]; 〒1540002 東京都世田谷区下馬4-16-5 Tokyo (JP). 長谷川 聖高 (HASEGAWA, Kiyotaka) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 加治屋 健太郎 (KAJIYA, Kentaro) [JP/JP]; 〒2368643 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-1 株式会社資生堂リサーチセンター (金沢八景) 内 Kanagawa (JP). 石松 弓子 (ISHIMATSU, Yumiko) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 尾郷 正志 (OGOU, Masashi) [JP/JP]; 〒1048010 東京都中央区銀座7丁目5番5号

株式会社資生堂内 Tokyo (JP). 吉田 誠一 (YOSHIDA, Seiichi) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 岸本 治郎 (KISHIMOTO, Jiro) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP). 茂呂 修 (MORO, Osamu) [JP/JP]; 〒2248558 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-1 株式会社資生堂リサーチセンター (新横浜) 内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 青木 篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF PREDICTING SPOT FORMATION ON THE SKIN WITH THE USE OF SPOT SITE-ACCELERATING GENES AS INDICATION AND METHOD OF SCREENING INHIBITOR FOR SPOT FORMATION ON THE SKIN

(54) 発明の名称: しみ部位亢進遺伝子群を指標とした皮膚しみ形成予知方法、皮膚しみ形成抑制剤のスクリーニング方法

(57) Abstract: It is intended to provide a skin examination method for predicting spot formation on the skin. This method is characterized by comprising judging the skin as having a high risk of spot formation in the case where the expression of MCP-2 gene, a polynucleotide hybridizable with mouse AK012157 gene, human FLJ21763 gene or rat S74257 gene under highly stringent conditions, or Mcp9, Mcp10, Isg15, Usp18, Oas12, Gbp2, Gtpi, Ifi47, Igtp, Tgtp, Sprr2A, Krt2-6b, Cdk5rap2, Mef2C, Gsta4, Osf2, Tnc, Igfbp6, Ppicap, MCP-6 or Mm.74656 gene is accelerated in the epidermis compared with the expression thereof in normal epidermis.

(57) 要約: 本発明は、皮膚しみ形成を予知するための皮膚検査方法を提供する。この方法は、表皮中のMCP-2遺伝子、又はマウスAK012157遺伝子、ヒトFLJ21763遺伝子もしくはラットS74257遺伝子に対し高ストリジェント条件下でハイブリダイゼーション可能なポリヌクレオチド、又はMcp9、Mcp10、Isg15、Usp18、Oas12、Gbp2、Gtpi、Ifi47、Igtp、Tgtp、Sppr2A、Krt2-6b、Cdk5rap2、Mef2C、Gsta4、Osf2、Tnc、Igfbp6、Ppicap、MCP-6もしくはMm.74656遺伝子の発現が正常な表皮中の発現に比べて亢進している場合、しみ形成のしやすい皮膚であると判断することを特徴とする。

WO 2005/033710 A1